

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局(43) 国際公開日
2007 年 1 月 11 日 (11.01.2007)

PCT

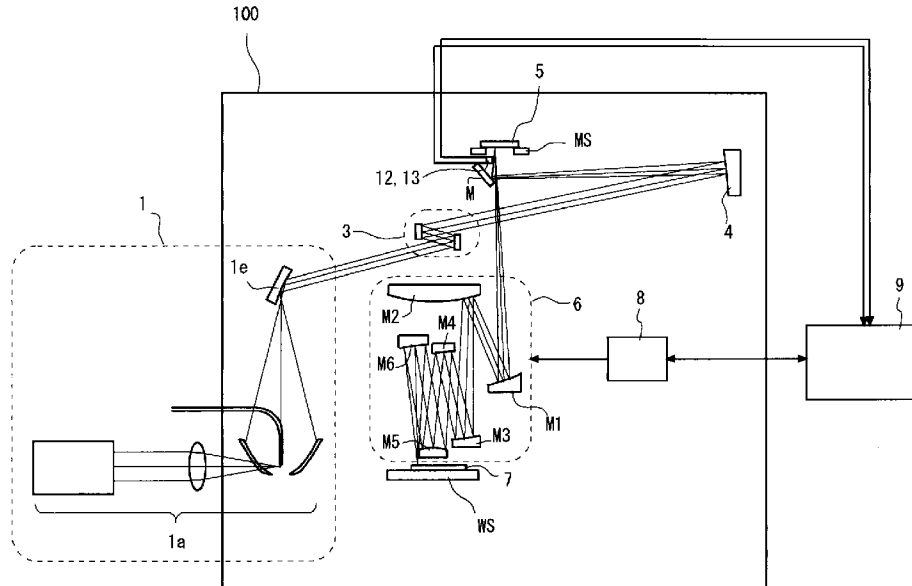
(10) 国際公開番号
WO 2007/004358 A1

- (51) 国際特許分類:
H01L 21/027 (2006.01) G03F 7/20 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2006/309657
- (22) 国際出願日: 2006 年 5 月 15 日 (15.05.2006)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願2005-197031 2005 年 7 月 6 日 (06.07.2005) JP
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 株式会社ニコン (NIKON CORPORATION) [JP/JP]; 〒1008331 東京都千代田区丸の内三丁目 2 番 3 号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 白石 雅之 (SHI-RAISHI, Masayuki) [JP/JP]; 〒1008331 東京都千代田
- (74) 代理人: 古谷 史旺, 外 (FURUYA, Fumio et al.); 〒1600023 東京都新宿区西新宿 1 丁目 1 9 番 5 号 第 2 明宝ビル 9 階 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD,

[続葉有]

(54) Title: EXPOSURE APPARATUS

(54) 発明の名称: 露光装置



(57) Abstract: Provided is an exposure apparatus by which characteristic fluctuation of an optical system due to light irradiation heat can be accurately grasped. The exposure apparatus which exposes a subject (7) to be exposed to light projected from a light source (1a) is characterized in that detecting means (12, 13, 9) for detecting a light quantity of non-exposure wavelength component of the light are provided. Therefore, even when the light quantity of exposure wavelength component and the light quantity of the non-exposure wavelength component independently fluctuate, the characteristic fluctuation due to the irradiation heat of the optical system can be accurately grasped. As a result, a high performance mirror adjusting system can be also provided.

(57) 要約: 本発明は、光の照射熱による光学系の特性変動を正確に把握することの可能な露光装置を提供することを目的とする。そのために、本発明の露光装置は、光源 (1a) から射出した光で被露光物 (7) を露光する露光装置

[続葉有]

WO 2007/004358 A1



SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

において、前記光の非露光波長成分の光量を検出する検出手段（12, 13, 9）を備えたことを特徴とする。したがって、たとえ、露光波長成分の光量と非露光波長成分の光量とが個別に変動しても、光学系の照射熱による特性変動を正確に把握することができる。その結果、高性能なミラー調整システムを実現することも可能である。